ジシロキサンセグメントを有する熱可塑性ポリイミドの物性 Physical Properties of Thermoplastic Polyimide with Disiloxane Segment

○大森隆史¹・高村厚²・伊藤信平²・佐々木大輔³・星徹⁴・萩原俊紀⁴・澤口孝志⁴・横田力男⁵ Takashi Omori¹, Atsushi Takamura², Shinpei Ito² Daisuke Sasaki³, Toru Hoshi⁴, Toshiki Hagiwara⁴, Takashi Sawaguchi⁴, Rikio Yokota⁵

Abstract: Polyimide is high heat-resistance resin, and widely used for an aerospace and electronics etc. Yokota et al. developed the aromatic polyimide (ISAS-TPI) having high solubility and high heat-resistance. Polyimide with disiloxane segment is expected to the improvement in adhesion with silicon wafer and grass surface. In this research, ISAS-TPI with disiloxane segment was synthesized by imidization of a-ODPA,4.4'-ODA and Apr-TMOS. The physical properties and application of the resulting polyimide were investigated.

1. 緒言

ポリイミドは芳香族酸二無水物と芳香族ジアミンを重合させポリアミド酸を合成したのち加熱また は化学的処理によりポリアミド酸をイミド化することによって合成され,高耐熱性樹脂であることか ら耐熱フィルムや宇宙航空分野の特殊膜材など幅広い分野で利用されている.その機能化の一つとし てポリイミド重合系中にジシロキサン含有ジアミンを共存させて得られたジシロキサン結合を持つポ リイミドは,ジシロキサン結合とシリコンウェハーなどのケイ素含有無機材料との密着性が向上する ことが古川らによって報告されている¹⁾.この性質を利用しシリコンウェハー加工時の高温工程に耐え 得る固定材としての応用が期待できる.しかし,一般的なポリイミドは非熱可塑性であり,難溶性で もあるため加工後の除去が困難であるという問題がある.横田らが開発した芳香族ポリイミド(ISAS-T PI)は非対称構造を分子骨格に導入することで高耐熱性と溶剤可溶性の両立を達成した²⁾.

本研究では、高耐熱性かつ一部の有機溶媒に可溶な熱可塑性ポリイミド PI(a-ODPA/4,4'-ODA)(ISAS-TPI)骨格にジシロキサンセグメント含有ジアミンである 1,3-ビス(3-アミノプロピル)テトラメチルジシ ロキサン(Apr-TMOS)をコモノマーとして導入した高耐熱性・熱可塑性ジシロキサンセグメント含有ポ リイミドの合成を試み、Apr-TMOS 含有量が熱物性及び機械物性に与える影響について調査した.

2. 実験

Table 1 の条件で芳香族酸二無水物:a-オキシジフタル酸二無水物(a-ODPA)を溶媒: N-N-ジメチルアセ トアミド(DMAc)を加え溶解させ、予め DMAc に溶解させた芳香族ジアミン: 4,4'-ジアミノジフェニル エーテル(4,4'-ODA)及び Apr-TMOS を等モルになるよう加え逐次重合し 5 種類のポリアミド酸溶液(ド ープ)を得た.





Scheme Reaction process of PI(a-ODPA/4,4'-ODA/Apr-TMOS)

その後, 調製した各ドープを製膜用コーター用いて UPILEX フィルムを貼ったガラス板の上に製膜し, エアオーブンを用いて 60℃で 2 時間, 150℃, 200℃及び 250℃でそれぞれ 30 分間段階的に加熱しイミ ド化させ PI(a-ODPA/4,4'-ODA/Apr-TMOS)フィルムを得た.

各フィルムの物性は赤外吸収スペクトル(IR), ゲル浸透クロマトグラフ(GPC), 示差走査熱量(DSC), 動的粘弾性(DMA)及び接触角測定などによって物性を評価した. さらに ISAS-TPI($M_n=1.7 \times 10^4$, $M_w=2$. 5×10⁴, $M_w/M_n=1.5$)の粉末と Run No.1(a-ODPA/4,4'-ODA/Apr-TMOS=1:0.5:0.5)のフィルムを Table 2 の 条件下で DMAc に溶解させブレンドポリマーを調製し DSC 測定を行った.

^{1:}日大理工・学部・応化, College of Science and Technology, Nihon Univ. 2:日大理工・院(前)・応化, Grad uate School of Science and Technology, Nihon Univ. 3:日大理工・客員研究員・応化, College of Science and Technology, Nihon Univ. 4:日大理工・教員・応化, College of Science and Technology, Nihon Univ. 5:宇宙機 構宇宙研 Institute of Space and Astronautical Science, JAXA

3. 結果·考察

イミド化前後のIRスペクトルにおいてポ リアミド酸フィルムに出現していたアミ ド由来のピークはイミド化により消失し, イミド由来のピークが出現したことから フィルムのイミド化を確認した. Table 1 に重合組成,重量平均分子量(M_w),ガラ ス転移温度(T_a)及び水の接触角(θ_c)を示す. M_wはNo.6 を除いて,どのジアミン仕込み 組成においても数万程度であった.

Figure 2 にジアミン中のApr-TMOSの 仕込みモル組成に対するPI(a-ODPA/4,4'ODA/Apr-T MOS)のDSC及びDMA曲線から求めた T_g 及び θ_c のプ ロット示す.ジシロキサンセグメント含有ポリイミ ドの T_g はApr-TMOS組成が増加すると共に徐々に低 くなり、50mol%の場合 132℃となった.これは導入 したジシロキサン結合の分子運動の自由度が大き いことによると考えられる.接触角測定においてA pr-TMOS組成10及び 50mol%では $\theta_{c,air}$ は78及び93° となりApr-TMOS仕込み組成の増加に伴い増加した。 これは、水との親和性の低いシロキサン結合が増加 したことによる.また、 $\theta_{c,PI}$ よりも $\theta_{c,air}$ の方が大きな 値を示した.

Table 2 にブレンド組成, Apr-TMOS 含量及び T_g を, Figure 3 にブレンドポリマー中の重量組成に対 する T_g のプロットを示す. ISAS-TPI に No.1 をブレ ンドすると T_g の低下が見られ, ①~③に単一の T_g が出現した. これは ISAS-TPI と作成したフィルム が相溶していることによると考えられる. しかし⑤ ~⑨においては T_g が徐々にブロード化し, ⑥及び⑦ では 2 つの T_g が出現した. これは 2 種のポリイミ ドは相溶していないことによると考えられる. また, No.1 が更に多い⑧及び⑨では単一の T_g が現れた.

| | Table 2 Blend | condition | . To and | ΛTg of blend polyme |
|--|---------------|-----------|----------|------------------------------|
|--|---------------|-----------|----------|------------------------------|

| Sample | No.1 [*] | ISAS-TPI | Apr-TMOS (TOTAL) | Tg | ∐Tg | | | |
|----------------------|-------------------|----------|---------------------|-------|------|--|--|--|
| | [wt%] | [wt%] | [wt%] | [°C] | [°C] | | | |
| 1 | 10 | 90 | 2.31 | 273.2 | 11.9 | | | |
| 2 | 20 | 80 | 4.62 | 264.4 | 11.0 | | | |
| 3 | 30 | 70 | 6.93 | 251.5 | 11.9 | | | |
| (4) | 40 | 60 | 9.24 | 240.9 | 22.4 | | | |
| 5 | 50 | 50 | 11.55 | 227.2 | 42.5 | | | |
| Ô | 60 | 40 | 12.96 | 150.4 | 21.3 | | | |
| 0 | 00 | 40 | 15.80 | 263.4 | 13.2 | | | |
| | 70 | 20 | 16.17 | 155.0 | 22.3 | | | |
| \bigcirc | 70 | 30 | 10.17 | 265.8 | 14.1 | | | |
| 8 | 80 | 20 | 18.48 | 158.9 | 27.1 | | | |
| 9 | 90 | 10 | 20.10 | 153.0 | 17.3 | | | |
| *Run No.1 in Table 1 | | | | | | | | |

Table 1 Characteristic of PI(a-ODPA/4,4'-ODA;Apr-TMOS)

| Run No. | 4,4'- ODA [mmol] | Apr- TMOS [mmol] | $M_w \times 10^4$ | T _g (DSC) [°C] | $\theta_{c, air}$ (air side) | $\theta_{c, PI}$ (PI side) |
|------------|------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 5 | 5 | 2.8 | 132 | 93 | 91 |
| 2 | 6 | 4 | 2.6 | 150 | 87 | 86 |
| 3 | 7 | 3 | 3.6 | 177 | 87 | 79 |
| 4 | 8 | 2 | 2.1 | 185 | 80 | 80 |
| 5 | 9 | 1 | 3.2 | 213 | 78 | 73 |
| 6 | 10 | 0 | 9.7 | 280 | 52 | 52 |



Figure 2 Plot of molar composition of Apr-TMOS in diamine feed vs. T_g and contact angle (θ_c) of PI(a-ODPA/4,4'-ODA/Apr-TMOS).



Figure 3 Plot of weight composition of No.1 vs. *T*_g of blend of PI(a-ODPA/4,4'-ODA/Apr-TMOS) and ISAS-TPI.

4.結言

- ・IR スペクトルによりジシロキサン含有ポリイミドの合成及びフィルム化を確認した. M_wは数万程度 であった.
- ・Apr-TMOS の含有量の増加に伴いガラス転移温度が減少し、280℃から132℃へと低下した.
- ・ISAS-TPI とのポリマーブレンドによってガラス転移温度の上昇を確認したが ISAS-TPI の組成が 60 \sim 70wt%では2種の T_g が観測され一部相溶していないことを示している.

5. 参考文献

- [1]古川信之,山田保治,「ケイ素含有化合物の芳香族ポリイミドへの導入効果」日本接着学会誌, 131 (10), 438-444(1995).
- [2] 横田力男,「ポリイミド新材料と世界初のソーラーセイル"IKAROS"の膜開発」,高分子学会予稿 集,60(2),2191(2011);横田力男,未来材料,Vol.13,No.2,63-68(2013)